

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成23年5月19日(2011.5.19)

【公表番号】特表2009-530821(P2009-530821A)
【公表日】平成21年8月27日(2009.8.27)
【年通号数】公開・登録公報2009-034
【出願番号】特願2009-500470(P2009-500470)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/302 1 0 1 Z

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月12日(2010.3.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子デバイス製造システムであって、
プロセスチャンバと、
インタフェースと、
軽減システムを備え、
プロセスチャンバは、望ましくない物質を含む流出物を産出するように用いられ、
インタフェースは電子デバイス製造システムについての情報を分析し、電子デバイス製造システムの稼動のための1又はそれ以上のパラメータを決定し、
電子デバイス製造システムは、インタフェースにより決定された1又はそれ以上のパラメータを用いて稼動するように用いられる電子デバイス製造システム。

【請求項2】

前記軽減システムは、前記インタフェースにより決定された1又はそれ以上のパラメータを用いて、望ましくない物質を希釈するように用いられる請求項1記載のシステム。

【請求項3】

前記情報が、前記電子デバイス製造システムにより提供される情報を含む請求項1記載のシステム。

【請求項4】

前記1又はそれ以上のパラメータが予測解を含む請求項1記載のシステム。

【請求項5】

前記軽減システムが、プラズマ軽減システムである請求項1記載のシステム。

【請求項6】

前記軽減システムが、触媒軽減システムである請求項1記載のシステム。

【請求項7】

前記軽減システムが、燃焼軽減システムである請求項1記載のシステム。

【請求項8】

前記情報はプロセスチャンバにより提供される情報を含む請求項1記載のシステム。

【請求項9】

前記情報は軽減システムにより提供される情報を含む請求項 1 記載のシステム。

【請求項 1 0】

軽減システムにより情報を受信する工程であって、前記情報が、望ましくない物質を有する流出物についてのものである工程と、

軽減システムで前記流出物を受ける工程とを含む方法。

【請求項 1 1】

望ましくない物質に関する前記情報が、予測解を含む請求項 1 0 記載の方法。

【請求項 1 2】

前記情報が、インタフェースにより提供される請求項 1 0 記載の方法。

【請求項 1 3】

前記電子デバイス製造システムに関する操作情報を、前記インタフェースに提供する工程を含む請求項 1 2 記載の方法。

【請求項 1 4】

前記望ましくない物質を、前記軽減システムにより希釈する工程を含む請求項 1 0 記載の方法。

【請求項 1 5】

前記望ましくない物質を、前記軽減システムにより希釈する工程が、前記望ましくない物質を反応物質と反応させる工程を含む請求項 1 4 記載の方法。